

基片加热台



HPS-1/6/7/8, 基片加热台

我们的现代铝基片加热器专为工业和临床实验室环境中的细胞学、组织学、病理学和其他生物学应用而设计。易于滑动拾取，温度极佳。准确度、均匀性、稳定性。

应用领域:

- ▶ 基片加热
- ▶ 基片干燥
- ▶ 原位分子杂交
- ▶ 玻片培养
- ▶ 组织学
- ▶ 解剖学
- ▶ Imuno 组织化学

可选选项: 高达42 基片



可选选项: 可编程 RAMP/SOAK 2 个程序, 每个程序8 段。

型号	HPS-1	HPS-6	HPS-7	HPS-8
加热工位	up10	up 21 片	up 27 片	up 45 片
温度调节	Digital front panel			
温度范围	RT +5 - 99.9°C (°C/ °F 可选择)			
数字微处理器	PID 控制器			
温度稳定性	±0.1°C			
准确度	±0.2°C			
功耗	400 Watt	900 Watt	-	-
电气要求	230V, 50/60Hz			
尺寸	W130xH185xD145mm	W190xH200xD210mm	W195xH160xD310mm	W300xH160xD310mm
重量	1.3Kg	2.4Kg	-	-